九州大学学術情報リポジトリ Kyushu University Institutional Repository

ヘリコン波によって生成されたプラズマ中の電子 ビーム

杉本, 尚哉 九州大学大学院総合理工学研究科高エネルギー物質科学専攻

小森, 彰夫 核融合科学研究所

田中, 雅慶 九州大学大学院総合理工学研究科高エネルギー物質科学専攻

河合, 良信 九州大学大学院総合理工学研究科高エネルギー物質科学専攻

https://doi.org/10.15017/17307

出版情報:九州大学大学院総合理工学報告.15(2), pp.195-202, 1993-09-01.九州大学大学院総合理工 学研究科 バージョン:

権利関係:

ヘリコン波によって生成されたプラズマ中の電子ビーム

杉本尚哉*・小森彰夫**
 田中雅慶***・河合良信***
 (平成5年5月31日受理)

Nonthermal Electron Tails in a Plasma Produced by Helicon Waves

Masaya SUGIMOTO, Akio KOMORI, Masayoshi TANAKA and Yoshinobu KAWAI

Nonthermal electron tails are observed in a highly-ionized plasma produced by helicon wave. It is experimentally found that when quantity $\delta = w/kv_{th}$ is nearly equal to the value δ_{max} , the nonthermal electron tails appear, where δ_{max} is the argument corresponding to the maximum Landau damping rate. This result strongly suggests that the tail electrons are generated by the Landau damping of helicon wave.

1. 緒 言

核融合,プラズマプロセシング,気体レーザー,イ オンビーム源などのプラズマ応用分野では,高電離高 密度プラズマの実現が重要な課題となっている.

最近,新しい高密度プラズマ生成法の1つとして, ヘリコン波を利用した方法が注目されている.ヘリコ ン波によるプラズマ生成は,利用する周波数が低い (MHz帯)ので安価な大出力高周波源を利用できる こと,ECR (Electron Cyclotron Resonance)に比べて 利用できる磁場領域が広いこと,同一高周波源で多種 類のガスをプラズマ化できること等の特徴を持つ.こ れまでに,ヘリコン波によって生成されたSF6プラ ズマによるエッチングや,Arプラズマによる高出力 レーザー発振等が報告されている¹⁾²⁾.

ヘリコン波は、当初は磁場の中に置かれた固体プラ ズマ中で磁力線方向へ伝わる電磁モードとして指摘さ れ、1960年代に理論的研究が進められた³³⁴⁾.実験的 には、1970年に Boswell がヘリコン波を励起すること によって高密度プラズマの生成が可能であることを示 して以来⁵⁾,電子密度が 10¹³~10¹⁴cm⁻³ の完全電離に 近いプラズマの生成が多数報告されている⁶⁾⁷⁾.

高密度プラズマ生成のためには、 ヘリコン波からプ

ラズマへ効率良くエネルギーが入力されなければなら ないが、ヘリコン波の衝突減衰を考慮しただけでは現 象を説明することはできない. Chen は、プラズマ中 に励起されたヘリコン波がランダウ減衰により電子に エネルギーを与え高密度プラズマが生成されるとする 理論を示した[®]. 実際に、プラズマ中に励起されたヘ リコン波の減衰率が、衝突減衰とランダウ減衰の両方 を考慮した計算値と一致することが示されている[®]. しかし、ヘリコン波によって生成されたプラズマ中に は、ある条件下で電子ビーム(Nonthermal electron tail)が観測されるなど、まだ未解決な問題も多い.

本研究では、ヘリコン波により生成されたプラズマ における電子ビームの発生を詳しく調べ、プラズマ生 成機構との関係を明らかにした.

2. ヘリコン波の分散とランダウ減衰

ヘリコン波は、 $\omega_{ci} \ll \omega \ll \omega_{ce} (\omega_{ci} : イオンサイク ロトロン周波数, \omega_{ce} : 電子サイクロトロン周波数) の周波数域で、磁力線に沿って伝播する右回り円偏向 の電磁波である.$

円柱プラズマ中でのヘリコン波の伝播は,変位電流 を無視したマックスウェル方程式と線形化したオーム の法則で解析できる.

$$\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \tag{1}$$

 $\nabla \times \vec{B} = \mu_{0j}^{\vec{I}} \tag{2}$

^{*}高エネルギー物質科学専攻博士後期課程

^{**}核融合科学研究所

^{***}高エネルギー物質科学専攻

$$\vec{E} = \vec{j} \times \vec{B}_0 / en_e \tag{3}$$

 $\vec{E}, \vec{B}, \vec{j}$ はそれぞれ電場,磁場,電流の1次の微小変 動量, n_e はプラズマ電子密度, \vec{B}_0 は外部磁場を表し ている.揺動は, $\exp[i(m\theta + k_z - \omega t)]$ にしたがって 変化しているとすると \vec{B} に関して

$$\nabla^{-2}\vec{B} + K^{2}\vec{B} = 0 \tag{4}$$

が得られる.ここで, $K = \omega e n_e \mu_0 / k B_0$ である.(4)式 を円柱座標成分に分けた時のz成分の方程式

$$\frac{\partial^2 B_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial B_z}{\partial r} + (K^2 - k^2 - \frac{m^2}{r^2}) B_z = 0$$
(5)

の解として r=0 で有限なベッセル関数 J_m (Tr) だけ を考える.ここで,

$$T^2 r^2 \equiv K^2 - k^2 \tag{6}$$

である.こうして得られる解において,境界条件を与えるとヘリコン波の分散式が得られる.一様なプラズマが, r=aで容器と接触している場合,その容器が

絶縁体であっても導体であっても分散式は

$$\left(\frac{\omega}{k} - \frac{en_e \mu_0}{B_0}\right)^2 - k^2 = \left(\frac{P'_{mn}}{a}\right)^2 \tag{7}$$

となる. P'_{nm} は第1種ベッセル関数 $J_m(x)$ 微分 $J_m(x)$ (x) の n 番目の零点である. 通常 $k^2 \ll K^2$ であるから,

$$\frac{\omega}{k} = \frac{P'_{mn}}{a\ell\,\mu_0} \, \frac{B_0}{n_e} \tag{8}$$

となる.

ヘリコン波はプラズマ中においてランダウ減衰によ り電子にエネルギーを与えると考えられる. ヘリコン 波のランダウ減衰率は、

$$\frac{Im(k)}{Re(k)} = 2\sqrt{\pi} \frac{c^2 T^2}{\omega_{pe}^2}$$
$$\times \delta^3 \exp(-\delta^2)$$
(9)

で与えられる.ここで, c は真空中の光速, ω_{pe} は電子プラズマ周波数, $\delta = \omega / k v_{th}$ で v_{th} は電子の熱速度である.



3. 実験装置

実験装置は,直径 45.7cm,長さ約 170cm の円筒形 のステンレス製真空容器に,パイレックス製放電管を 接続し,真空容器に沿って12個の外部磁場発生用コイ ルを配置したものである.Fig.1(A)は,その概略 図である.真空容器は,6インチ拡散ポンプにより,約 10⁻⁷Torr に排気される.実験は,2~16×10⁻⁴Torr の圧力のアルゴンガスを充てんして行った.アルゴン ガスは,パイレックス製放電管の端から,ニードルバ ルブを介して供給される.磁場配位は,Fig.1(B)に 示すように一様磁場で,最大2kGまでかけられる.

パイレックス製放電管は内径 5cm, 長さ 50cm で, その外側に内径 6cm, 長さ 30cm のパイレックス円筒 管をかぶせて, プラズマ生成用アンテナを取り付けて いる. アンテナは, 幅 2.5cm の銅板を螺線状に半 ターン巻いた構造をしており, 長さは 25cm である (Fig. 2). これに高周波を印加して, m=1 のヘリコ ン波を励起する. 放電管上に直接アンテナを巻いてい ないので, アンテナの位置は変えることが可能で取り 外しも容易である.



プラズマ生成に用いる高周波は、周波数 7MHz の 正弦波である. 伝送系の過熱を防ぐため、83.3Hz, 16.7% duty cycle の方形波パルスを用いて高周波に 振幅変調をかけている. 高周波は、2ms の間発振さ れ、10ms の間だけ行われる. 発振器から出力された 高周波は、2台の小型アンプにより最大 30W にまで 増幅された後、大型アンプによって最大 3kW にまで 増幅された。増幅された高周波は、大型アンプとプラ ズマとのマッチングをとるために置かれた 2000pF の 真空バリコンと、これに接続されている 50Ω の同軸 ケーブルを介して、アンテナに供給される. 実質的に プラズマ生成に使われるパワーは、反射等による損失 を考えると実測値よりも幾分少ないものと考えられる. プラズマパラメータ及び電子ビームの測定は、軸方 向(z方向)に可動なラングミュアプローブを用いて 行った.プラズマはパルスで生成されるため、ボック スカー積分器を用いて測定した.プローブ信号取り込 みのゲート開口時刻は自由に変えることが可能であり、 ゲート開口時間は 0.1ms で測定を行った.

4. 実験結果と考察

実験は、磁場の強さ、アルゴンガスの圧力、測定時 刻、アンテナからの距離などを変化させて行った.測 定時刻は高周波を印加し始めてからの時刻を基準に採 っている.アンテナからの距離はアンテナの端から測 ったものである.

Fig. 3 (A) は、電子密度 n_eと電子温度 T_eの磁場 依存性を示したもので, ガス圧 p は 8×10⁻⁴Torr, RF のパワー P_{RF} は 1kW, 測定時刻 t は 0.4ms, ア ンテナからの距離 z は 10cm である. ne は、外部磁場 B_0 が 1kG よりも小さいときには B_0 に比例している. 磁場領域では n_eと B₀の関係はヘリコン波の分散と 合っている. B_0 が 1kG よりも大きくなると n_c は 2.0 ~2.4×10¹³cm⁻³ で飽和して一定となる. p=8×10⁻⁴ Torr の時, 常温 (300K) での中性粒子の密度は 2.6 ×10¹³ cm⁻³ で, B_0 が 1kG より大きい時の n, とほぼ 一致していることから、中性粒子はほぼ完全に電離し ているものと考えられる.T.は5~7eV である.プ ラズマがほぼ完全電離に近い状態でのみ電子ビームが 観測された. Fig.3 (B) は電子ビームの密度 n, と温 度 T_b の磁場依存性である. n_b は 1.2~1.6×10¹² cm⁻³, T_bは5~8eV である. Fig. 3 (C) は電子ビームのエ ネルギー E, の磁場依存性を示したもので、20~23eV である. ヘリコン波により加速された電子は、中性粒 子の電離に使われてプラズマの電離度は上がる.磁場 が弱い時はプラズマは完全に電離しておらず、加速さ れた電子のほとんどは電離に使われる. しかし磁場が 強い場合、プラズマはほぼ完全に電離しており、電離 に使われずに余った速い電子が電子ビームとして観測 されると考えられる. ランダウ減衰による減衰率 Im (k) / Re(k) を実験値から計算すると, 500G の時 Im (k) $/Re(k) = 1.3 \times 10^{-2}$, 1.3kG の時 Im(k) / Re(k) =9.6×10⁻³となり、500Gの時の方が大きい.しかし、 ヘリコン波の位相速度は 1.3kG の時の方が大きいた め、ランダウ減衰により加速される電子のエネルギー も大きい. アルゴンの電離断面積が 50eV 付近までは



Fig. 3 Electron density n_e and temperature T_e (A), beam density n_b and temperature T_b (B) and beam energy E_b (C) as a function of magnetic field intensity.



Fig. 4 Pressure dependence of electron density n_e and temperature T_e (A), beam density n_b and temperature T_b (B) and beam energy E_b (C).



Fig. 5 Time evolution of electron density n_e and temperature T_e (A), beam density n_b and temperature T_b (B) and beam energy E_b (C).



Fig. 6 Axial profiles of electron density n_e and temperature T_e (A), beam density n_b and temperature T_b (B) and beam energy E_b (C).

急激に増加することから考えると,500Gの場合の方 がランダウ減衰は強いが加速された電子のエネルギー が低いため,電離プロセスに対する寄与も小さくまた 電子ビームも観測されにくいと考えられる.

Fig. 4 (A) は電子密度 n_e と電子温度 T_e の圧力依 存性を示したものである. P_{RF} は 1kW, z=10cm, t =0.3ms, B_0 t 1.3kG $caso. p=1.0 \times 10^{-3}$ Torr tastron tでは, n_{μ} は ρ とともに増加しており, 圧力の低い領 域では中性粒子はほぼ完全に電離しているものと考え $5 n \delta$. $p > 1.0 \times 10^{-3}$ Torr \tilde{c} is n_{e} is 2.7×10^{13} cm⁻³ となって飽和する.これは、 $P_{\rm RF}$ の値がすべての中性 粒子を電離させるほど大きくはないからである. T. は p が小さい場合には約 20eV と高いが、 p が大きく なると下がって約 5eV となる. Fig. 4 (B) は電子 ビームの密度 n_b と温度 T_b の圧力依存性を示したも のである. p≥5.0×10⁻⁴Torr の場合に電子ビームが 観測された. n_bは 1~2×10¹²cm⁻³で, p が小さい側 で大きくなる傾向が見られる. ヘリコン液の分散式か らわかるように、位相速度 ω/k は B_0/n_e に比例する. pが小さい時には n_{e} も小さいので ω/k は大きくなり, ランダウ減衰により加速される電子エネルギーも大き い. pが小さくなると E_b が大きくなるのはこのため であると考えられる. ρがさらに小さくなるとω/k の値はさらに大きくなり、bulk のテール部がのびて T. が高くなり、電子ビームは観測されにくいと考え られる.

Fig. 5(A) は電子密度 n_e と電子温度 T_e の時間変 化を示したものである. $P_{\rm RF}$ は 1kW, z=10cm, p=8 ×10⁻⁴Torr, B_0 =1.3kG である. n_e は高周波を印加 し始めてから 0.2ms までの間に急激に増加して 2.6 ×10¹³cm⁻³ となった後, 徐々に減少して 0.8ms 以後 ~8×10¹²cm⁻³ で一定となる. T_e は時間が経つにつれ て ~6eV から ~12eV へと高くなる. 電子ビームは, 高周波を印加し始めた直後の n_e が大きい時期に観測 された. **Fig. 5**(B) は電子ビームの密度 n_b と温度 T_b の時間変化である. 電子ビームは 0.7ms 以後観測さ れなかった. **Fig. 5**(C) 電子ビームのエネルギー E_b の時間変化で, E_b は 18~25eV で時間とともに小さ くなる. *T_e* が時間とともに上昇するのは,加速された電子の一部による電子加熱のためであると思われる.

Fig. 6 (A) は、電子密度 n_e と電子温度 T_e のアン テナからの距離に対する変化である. $P_{RF}=1kW$, B_0 =1.3kG, $p=8\times10^{-4}$ Torr, t=0.3ms である. **Fig. 6** (B) は電子ビームの密度 n_b と温度 T_b のアンテナか らの距離に対する変化である. プラズマは, アンテナ からの距離が 0cm から 50cm 付近まで非常に電離度 が高いが,電子ビームはアンテナから 7~30cm の所 でしか観測されなかった. 30cm 以遠では高密度であ るにも関らず,電子ビームが観測されない理由は今後 検討していく必要がある. **Fig. 6** (C) は電子ビームの エネルギー E_b のアンテナからの距離に対する変化を 示したものである. E_b は距離によらず 20eV 前後で あまり変化していない.

最後に, (9)式において $\delta^{3} \exp(-\delta^{2})$ は, $\delta = \sqrt{6/2} \approx 1.22$ において最大となる.実験で得られた 値からるの値を計算してみると,電子ビームが観測さ れる場合, $\delta = \omega/kv_{th}$ の値は0.9~1.73となって1.22 に近いことがわかる.したがって観測される電子ビー ムはヘリコン波のランダウ減衰により加速された電子 であると考えることができる.

参考文献

- 1) P. Zhu and R. W. Boswell, Phys. Rev. Lett. **63**, 2805 (1989).
- P. Zhu and R. W. Boswell, J. Appl. Phys. 68(5), 1981 (1990).
- 3) J. P. Klozenberg, B. McNamara and P. C. Thonemann, J. Fluid Mech. **21**, 545 (1965).
- J. A. Lehane and P. C. Thonemann, Proc. Phys. Soc. 85, 301 (1965).
- 5) R. W. Boswell, Phys. Lett. 33A, 457 (1970).
- 6) 庄司多津男,高周波加熱におけるプラズマの輸送と制御 に関する理論・シミュレーション研究,13 (1987.6).
- P. K. Loewenhardt, B. D. Blackwell, R. W. Boswell, G. D. Conway and S. M. Hamberger, Phys. Rev. Lett. 67, 2792 (1991).
- 8) F. F. Chen, (Submitted).
- 9) A. Komori, T. Shoji, K. Miyamoto, J. Kawai, and Y. Kawai, Phys. Fluids **B3(4)**, 893 (1991).